

第8回シリコン材料の科学と技術フォーラム 2018

2018年11月18日(日)～21日(水)

岡山大学創立五十周年記念館

1st Announcement



主催：(独) 日本学術振興会 結晶加工と評価技術 第145委員会
シリコン材料の科学と技術フォーラム 2018 実行委員会

委員長： 岡山県立大学 末岡 浩治
副委員長： 信州大学 太子 敏則
岡山大学 山下 善文
物質・材料研究機構 (NIMS) 深田 直樹
産業技術総合研究所 (AIST) 棚橋 克人

アドバイザー： 明治大学 田島 道夫 九州大学 柿本 浩一
九州工業大学 金田 寛 茨城大学 村上 進
東京工業大学 鹿島 一日兒

委員： SUMCO 栗田 一成 電力中央研究所 土田 秀一
明治大学 小椋 厚志 SUMCO 佐俣 秀一
岡山大学 鶴田 健二 金沢工業大学 上田 修
筑波大学 上殿 明良 名古屋大学 宇佐美 徳隆
関西学院大学 大谷 昇 リガク 表 和彦
大阪大学 酒井 朗 大阪大学 佐野 泰久
大阪大学 志村 考功 九州大学 西澤 伸一
千葉工業大学 山本 秀和 信越半導体 竹野 博
キヤノン 高橋 秀和
物質・材料研究機構 (NIMS) 関口 隆史
ファインセラミックスセンター 石川 由加里
グローバルウェーブズ・ジャパン 藤森 洋行
グローバルウェーブズ・ジャパン 泉妻 宏治

事務局： 岡山大学 山下 善文

場所：岡山大学創立五十周年記念館 (津島キャンパス)
(<http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/kinenkan-index.html>)

期日：平成30年11月18日(日)午後4:00(受付開始)～21日(水)午後2:30

- 目的：1. 次世代LSI基板としてのSi材料とSi関連デバイス、さらにパワーデバイス、イメージセンサ、Si系太陽電池などの開発に必要な材料の製造技術、評価技術、及び処理技術に関わる基礎研究と応用研究の交流。
2. 若手研究者、技術者の教育と活性化、及び国際活動力の向上。
3. 直面する問題をブレークスルーするための全員参加の討論。

趣旨：上記の目的で第8回フォーラムを開催します。フォーラムでは、招待講演、口頭発表、及びポスター発表を中心に活発な討論を展開します。フォーラムの期間を通じて十分な自由討論ができるように、時間的及び場所的なアレンジがなされています。若手の教育にも十分配慮されています。発表論文は全て英文プロシーディングスに掲載され、世界に向けて公表されます。

参加費：35,000円(一般) 15,000円(学生)

問合せ先：岡山大学 山下 善文

電話：086-251-8231

電子メール：yoshifumi.yamashita@okayama-u.ac.jp

岡山県立大学 末岡 浩治

電話：0866-94-2136

電子メール：sueoka@c.oka-pu.ac.jp

Web：<http://www.ec.okayama-u.ac.jp/~dm/siforum/>